

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年3月26日(26.03.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/041011 A1

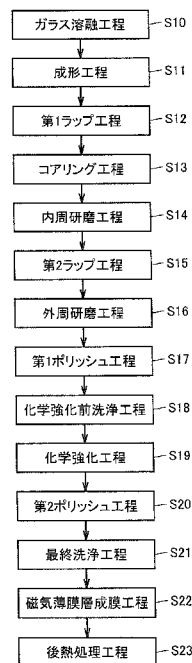
- (51) 国際特許分類:
G11B 5/84 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/072303
- (22) 国際出願日: 2014年8月26日(26.08.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-191767 2013年9月17日(17.09.2013) JP
- (71) 出願人: H O Y A 株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 福本 直之 (FUKUMOTO, Naoyuki); 〒1007015 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 コニカミノルタ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人深見特許事務所 (FUKAMI PATENT OFFICE, P.C.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING GLASS SUBSTRATE FOR INFORMATION RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 情報記録媒体用ガラス基板の製造方法

FIG.6



- S10 Glass melting step
S11 Molding step
S12 First lapping step
S13 Coring step
S14 Inner perimeter polishing step
S15 Second lapping step
S16 Outer perimeter polishing step
S17 First polishing step
S18 Chemical strengthening/pre-washing step
S19 Chemical strengthening step
S20 Second polishing step
S21 Final washing step
S22 Step for forming magnetic thin-film layer
S23 Post-heat treatment step

(57) Abstract: This method for manufacturing a glass substrate for an information recording medium is provided with a step for washing a glass substrate (1), and a step for chemically strengthening the surface of the glass substrate (1) after washing the glass substrate (1). The step for washing the glass substrate (1) includes a step for performing washing such that the residual quantity of cerium oxide measuring 0.1 μm or more in diameter on the inner-perimeter-end surface of the glass substrate (1) is 3 particles/ mm^2 .

(57) 要約: この情報記録媒体用ガラス基板の製造方法は、ガラス基板(1)の洗浄を行なう工程と、ガラス基板(1)の洗浄を行なった後に、ガラス基板(1)の表面を化学強化する工程とを備え、ガラス基板(1)の洗浄を行なう工程は、ガラス基板(1)の内周端面(4)において、 $\phi 0.1 \mu\text{m}$ 以上の酸化セリウムの残渣量が3個/ mm^2 以下となるように洗浄を行なう工程を含む。



PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))